

474919-2026 - Licitación

Países Bajos – Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas) – European Tender
Electron Beam Lithography system
OJ S 130/2026 09/07/2026
Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal - Anuncio de cambios
Suministros

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Universiteit Twente
Correo electrónico: c.delfgaauw@utwente.nl
Naturaleza jurídica del comprador: Empresa pública
Actividad del poder adjudicador: Educación

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: European Tender Electron Beam Lithography system
Descripción: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Identificador del procedimiento: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa
Identificador interno: 379fcf7e-45c5-4d48-b8ea-3be831450e85
Tipo de procedimiento: Abierto
El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros
Clasificación principal (cpv): 38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
Clasificación adicional (cpv): 38341100 Registradores de haces electrónicos

2.1.2. Lugar de ejecución

País: Países Bajos
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria: Zie documentatie

2.1.3. Valor

Valor estimado, IVA excluido: 3 500 000,00 EUR

2.1.4. Información general

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusión

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000

Título: European Tender Electron Beam Lithography system

Descripción: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.

Identificador interno: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

Clasificación adicional (cpv): 38341100 Registradores de haces electrónicos

5.1.2. Lugar de ejecución

País: Países Bajos

En cualquier parte de un país dado

Información complementaria: Zie documentatie

5.1.3. Duración estimada

Duración: otra información: Desconocido

5.1.5. Valor

Valor estimado, IVA excluido: 3 500 000,00 EUR

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación, Documento europeo único de contratación (DEUC)

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://s2c.mercell.com/today/217278>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Permitida

Dirección para la presentación: <https://s2c.mercell.com/today/217278>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: inglés

Catálogo electrónico: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Permitida

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Rechtbank Overijssel

Información sobre los plazos de revisión: See descriptive document.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso:

Universiteit Twente

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Universiteit Twente

Número de registro: 50130536

Dirección postal: Drienerlolaan 5

Localidad: Enschede

Código postal: 7522NB

Subdivisión del país (NUTS): Twente (NL213)

País: Países Bajos

Punto de contacto: Camilio Delfgaauw

Correo electrónico: c.delfgaauw@utwente.nl

Teléfono: +31534891512

Dirección de internet: <https://www.utwente.nl>

Perfil de comprador: <https://s2c.mercell.com/buyer/16033>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Rechtbank Overijssel

Número de registro: 82940525

Localidad: Almelo

Código postal: 7607 GB

Subdivisión del país (NUTS): Twente (NL213)

País: Países Bajos

Correo electrónico: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl

Teléfono: (+31)0883611042

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

10. Modificación

Versión del anuncio anterior que debe modificarse

:

d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01

Principal motivo de la modificación

:

Corrección comprador

Descripción

:

Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several (minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability; G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes – the subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1. Modificación

Identificador de sección: LOT-0000

Los pliegos de contratación se modificaron el: 08/07/2026

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4 - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Anuncio: fecha de envío (por parte del eSender): 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: inglés

Número de publicación del anuncio: 474919-2026

Número de la edición del DO S: 130/2026

Fecha de publicación: 09/07/2026